

Facteurs de procédé type	Gaz <i>i</i>											
	CF <sub>4</sub>	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	CHF <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	o-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	NF <sub>3</sub> Isolé	NF <sub>3</sub>	SF <sub>6</sub>	C <sub>4</sub> F <sub>6</sub> <sup>a</sup>	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub> <sup>a</sup>	C <sub>4</sub> F <sub>8</sub> O <sup>a</sup>
Etch 1-U <sub>1</sub>	0,7	0,4 <sup>1</sup>	0,4 <sup>1</sup>	0,06 <sup>1</sup>	S. O.	0,2 <sup>1</sup>	S. O.	0,2	0,2	0,1	0,2	S. O.
Etch P <sub>CF<sub>4</sub></sub>	S. O.	0,4 <sup>1</sup>	0,07 <sup>1</sup>	0,08 <sup>1</sup>	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	S. O.	0,3 <sup>1</sup>	0,2	S. O.
Etch P <sub>C<sub>2</sub>F<sub>6</sub></sub>	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,2	S. O.	S. O.	S. O.	0,2 <sup>1</sup>	0,2	S. O.
CVD 1-U <sub>1</sub>	0,9	0,8	S. O.	S. O.	0,4	0,1	0,02	0,2	S. O.	S. O.	0,1	0,1
CVD P <sub>CF<sub>4</sub></sub>	S. O.	0,1	S. O.	S. O.	0,1	0,1	0,02 <sup>2</sup>	0,1 <sup>2</sup>	S. O.	S. O.	0,1	0,1
CVD P <sub>C<sub>3</sub>F<sub>8</sub></sub>	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	S. O.	0,4

<sup>1</sup> Estimation comprenant les procédés de gravure à gaz multiples.

<sup>2</sup> Estimation reflétant les procédés de gravure à gaz multiples à faible teneur en potassium et en carbure qui peuvent contenir des additifs de GES fluorés carbonatés.